PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-098106

(43)Date of publication of application: 30.03.1992

(51)Int CI

G01B 11/24

(21)Application number: 02-216017

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

16.08.1990

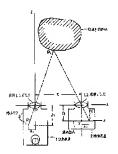
(72)Inventor: TAMAMURA YOSHIAKI

(54) THREE-DIMENSIONAL SHAPE MEASURING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To uniformly enable measurement without being restricted by the size of a measured object by projecting a lattice pattern constituted by slit rows on the measured object, and by detecting a slit image having a maximum brightness.

CONSTITUTION: The position of the image projected by the ray of light passed through a slit Pi in a lattice pattern 3 on a measured object 0 through a projecting lens L1 is made to be Pi. This image is formed at a point Pi on an imaging plane A through an imaging lens L2, in an imaging device 2. At that time, by measuring the position Xi of the image of the point Pi on the imaging plane A, the three-dimensional coordinates of the point Pi on the measuring object 0 can be calculated. Thus, not only the three-dimensional position of a point on the object along the slit image but also that of an arbitrary point on the object situated in the space between slit images can be measured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Date of registration

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

@ 日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 頤 公 間

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-98106

@int.Cl.5

庁内整理番号 織別記号

@公開 平成4年(1992)3月30日

G 01 B 11/24

C 9108-2F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全10頁)

60発明の名称 3次元形状計測方法

> @# 類 平2-216017

顧平2(1990)8月16日 @H.

(72)発明者 玉 串

東京都千代田区内幸町1丁日1番6号 日本電信電話株式 会社内

日本衛信雷話株式会社 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 6 号 の出 願 人

60代 理 人 弁理士 澤井 敬史

- 1. 発明の名称 3 次元形状計劃方法 2. 特許請求の新聞
- (1) 祭品系列に従って色の説明輝度が柳のピッ チ方向に一定の割合で変化するように特徴づけた スリット列で構成される符号化格子パターンを接 計測物体に控影し、これを振像した順像からのス リット像を検出し、色輝度領を比較して色符号を
- 抽出し、その抽出したスリット像の色符号の系列 を復号することにより、各々のスリット値を投影 格子のスリットに対応づける第1の工程と、禁工 程でもって対応づけられたスリット保に含まれる
- 点に対して、当該スリット像の色符号に対応する 色成分の輝度値を計測し、当該スリット像内の極
- 大/極小輝度値とから、上記画像内の点の位置を 上記投影格子パターン面上の位置に対応づける第 2 の工段とにより終計制額体の位置と形状を計劃
- することを特徴とする3次元形状計測方法。
- (2) 俗母系列に従って会またはスリット関ロ幅。

- 照明報度等の変化により熱散づけたスリットが答
- 間隔に配置された第1の符号化格子投影パターン と照明輝度が横のピッチ方向に一定の割合で変化
- するように特徴づけた祭2の特影パターンを用い、 上記第1の符号化格子投影パターンを被計測物体
- に投影し、これを摄像した第1の画像から各々ス
- リット像を検出し、上記典主たはスリット回口幅。 照明解度等の特徴を比較することにより符号を抽
- 出し、その抽出したスリット像列の符号系列を復 号して各々のスリット像を上記第1の符号化格子
- 投影パターンのスリットに対応づける嬉しの工程
- と、上記第2の投影パターンを被計劃物体に投影 し、これを損像した第2の画像を得、当該画像の
- 任意の点における輝度値と当該任業の点に顕接す
- る上記第1の函像における2本のスリット像の位 翌に各々対応する第2の面像の輝度値により、第
- 2の画像の任意の点を符号化株子校影パターン面
- の位置に対応づける第2の工程とにより被計測物 体の位置と形状を計測することを特徴とする3次

- 2 -

元形 状 計 湖 方 法。

特脚平 4-98106(2)

(3) 周期的に照明球度が横のピッチ方向に一定 の知合で変化するように特徴づけた第2の投影パ ターンと、装飾 2 の投影パターンにおける上記頭 開経度の周期的な変化の位置を移動することによ って機能された集3の投影パターンとを用い、当 該第2及び第3の投影パターンを各々被計測能体 に投影し、第2及び男3の画像を磁像し、前記請 水原(2)記載の第1の工程により第1の符号化格 子段影パターンの破損するスリットに各々対応づ けられた第1の画像内の隣接したスリット像及び 当該スリット像間の任意の点における面像の輝度 値について、上記対応づけられた符号化格子投影 パターン面のゴリットの位置が、 上記第2および 毎3の投影パターン面において、照用輝度が様大 もしくは極小値付近とならないような、上記第2 あしくは低3の投影パターンに対する第2もしく け無るの前後を選択してそれぞれ計別し、上記面 協内の任意の点を前記第1の符号化格子投影パタ - シェトの位置に対応づける無2の工程により被 計測的体の位置と形式を計測することを特徴とす

人 3 水 元 影 北 計 形 方 形。 3. 発明の詳細な説明

(商業上の利用分野)

本税明は符号系列に従って色またはスリット開 口幅、照明輝度等を変化させたスリット列により 構成される格子パターンを被計測物体に投影し、 当該物体を撮像した画像のスリット像とその符号 を検出することによって、非接触で3次元物体の 位置と形状を計測する方法に関する。

(従事の技術)

従来より、物体の3次元位置や形状を計測する ための種々の技術が開発されてきている。とくに 米を用いた計測法は非接触で計測であることから、 T. 等、 医療などの分野で広く利用されている。

この種の計測法にも種々の方法があるが、スポ ット米やスリット光を動体に開射して構像した米 後の位置から3次元位置を計測する方法、核子パ ターンを照射した効体を開送か終子を通して抑制 するチアレル、などが従来からの代表的な方効で ある.

-4-

- 3 -

しかしながら、前者の方法では、スポット光や

スリット光を走査してその都度顕像を撮像しなけ ればならないため、計測に時間がかかり、繋いて いる物体の計測などが栄養であるという問題があ り、また役者のモアレ法では、物体の凹凸の判別 や、位置や形状の絶対計劃が難しいという問題が ある.

上記の問題を解決する方法として、空間的また は時間的に符号化したパターン光を被計画物体に 投影する方法が提客されている。これらの方法で は、被計測物体を振像した画像から光像の符号を 解読し、それぞれの光像が投影パターンのどの謎 分からの光によるものであるかを対応づけるよう じかされており、この効果三角非により物体の3 次元位置や形状の絶対計測が可能になる。

上記の空間的に符号化したパターンを投影する 方典には、スリット列を透過光の他の濃度、スリ ット努口帽、スリット長などの変化により特徴づ けて符号化する方法(A)や、透過率や色が一定に 変化するようにしたパターンを用いる方法(B)な レがある.

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の前者の方法(A)では、撥像した 画像から検出した夫々のスリット像の色や濃度。 スリット同口幅やスリット長などの特徴から符号 を擠出し、これを復号して投影したスリットと対 応づけを行うことにより物体の3次元位置や形状 を針捌する。しかし、この方法では、スリット列 を使用しているため、スリットが投影されている 部分しか計測できないために、物体の形状を把握 しにくいという問題がある。

これに対して、後者の方法(B)では透過率や色 が一定に変化するようにしたパターンを用い、機 **なした開像の額度や色により、投影パターンに対** 応づける方法をとっているため、パターンが投影 された物状が観測できるわぎり 効体上の任意の 点の3次元位置を計測することができるという特 敬がある。ただし、この方法では罰像から輝度や 色のわずかの変化を裁別する必要があるため、機 Q装製のノイズの影響を受け易いという問題があ

- 6 -

る。また、約者方法(ハ)の符号化スリット列を用いるのに比べて、計劃できる物体の大きさも制設される。

一力、預数の有争化したパターン先を時裏打的 に按断する力強(C)でも、様々の符号化力能が提 寒されている。この力能の人きな問題は、時系列 的に複数の内値を観到する必要があるため、動き の早い確保などに適用するのが難しいことである。 (毎期の日本)

本発明は上述した従来の方法(A)、(B)及び(C)の問題点を解決し、スリット列により開始される格子パターンが起す影物体に侵勢されている物体の一部のみでなく、パターン投粉及び顕微解 関可能であるような領域については、一様にかつ 高速に弁技能でお願できる3次元形状計劃方能を 建筑することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記課題を解決し目的を達成するため、 符号系列に従って色の照明輝度が横のピッチ方 前に一定の割合で変化するように禁附づけたスリ

(作用)

本典明は符号系列に従っても、またはスリット 関ロ編、照明版度等を変化させたスリット列によ リ構成される格子パターンを域計算等にに投影し これを複像して得られる原油から、輝度の最も高 いスリット線を検出して、その特徴から符号を抽 出し、復号によりこれらを投影パターンのスリッ

- 8 -

-7-

トに対応づけることにより、スリット像上の点の 3 次元保度を計断するとともに、スリット像の間 部部分の点については、その点の輝度や像などの 特別を検討し、編指するスリット像の計画値を補 間することにより、3 次元保度を定める。

この結果、スリットが投影されている他体の一 のみでなく、パターン投影的よび場合観察可能 であるような領域については、物体の大きに収 限されることなく一様に打削することができるは か、名字な3次元物体の打断力法を実現すること ができる。

(実施例)

第1回は本先明方法を実施するための計算送費の基本的な関域影響のある。回において、1は様子パターン3を維計測能体のに段影するための段数数数。2は維性解能体を観測するための得象数3はスリット列などより成る様子パターン。 し1し2はそれぞれ投影検数1の段影レンズだおよび通常数異2の順像レンズである。回のように関域をれた数値により、3次元計算を行う原列を効率に

説明する。

図に示すように、格子パターン3のあらスリットゥ」を通った光が、投影レンズしIにより検別 物体の上に投影された他の位度をpiとする。 この像が順像装置2において、操像レンズ1,2を 迫して、制作調本人の成立。に以降しているとす る。このとき、点piの場の物量面入上での位置 は、と計割することにより、特計制物体の上の点 piの3次元限度が単出できる。更のように、投 影レンズし1の中心を展点に、光軸を2軸とする 展標系を定めると、piの限度傾(Xi, Yi, 乙)は次式によりまえれる。

$$X_1 = x_1 Z_1 / \hat{z},$$

$$Y_1 = y_1 Z_1 / \hat{z},$$

$$Z_1 = D \hat{z}, \hat{z}, / (u_1 \hat{z}, + x_1 \hat{z},)$$
...(1)

ただし、 & 、は投影レンスし I と格子パターン 3 間の距離、 & 、は機像レンズ L 2 と機像 面 A 間 の距離、 D は投影レンズ L 1 と機像レンズ L 2 の 中心間の距離である。また、 u 、は格子パターン

3 中で注目しているスリットロ,と投影レンズ ししの光動との間の距離であり、株子パなーン3 のピッチをp。投影レンズLlの光軸から数えた スリット p.の番号を:とすると、 u.=p×iで ある. 第1回の計算は暫に上り動体の3次元の智や形

状を計測を行うためには、(1)式から用かた如く、 掛金したスリット像の奈様低×、と、投影された スリットの格子パターン3の面上での座標値। もしくはスリット番号」が測定されなければなら ない。このとき、投影核子パターン3が名数のス リットから構成されていると、掛像されたスリッ ト値が、それぞれ投影やそのどのスリットに対応 しているかを知らなければならない。

第2回は本発明の一実施免である第1回の格子 バターン3の構成例である。第2例(a)に示すよ うに、格子は一定の簡稱 D を有するスリット形で 構成され、一定の符号系列、例えば3次元の最大 長系列符号に従って、それぞれR(お) G(縁) B (青) の色で特敵づけされている。

また、福例(b)に示すように、スリットとスリ ットの関係は、左側のスリットの色の無痕類度が 一定の割合で変化するように色づけされている。 このようにして構成された格子パターンを、第1 図の計測装製によって物体上に投影し、繊維装置 2によって頭像を提進する。

が3回は価値装置2によって得られた価値の… 例及び拜度レベルの変化例であって、第3団(a) は第2回(a)の如き格子パターンを投影した物体 の爾像(これを格子像とよぶ)の例を、第3図(b) は当該衛便の艇方向(v 方向)の位置を一定(v.) にして、 R (赤)成分を横方向(×方向)に走査した ときの輝度レベルIRの変化の例を、それぞれ示 したものである。ただし、対象物体は、色や模様 の変化がなく、光学的な特性が均一であるとする。 次に頻3図(a)の如き無像から、被計測物体O が3次元物体の3次元位置および形状を算出する 方法について脱明する。対象の被計測物体の表面 に色や機様がなく、光学的に均一ならば、第3回 (b)の如き。第3回(a)の亜線の尺成分を×方向に

- 11 -

走査して得られた輝度レベル」Rは、 第2回の株

子パターンの光学的な特性を反映し、周期的に要 化している.

第3図(b)は、R成分について輝度レベルIR の変化の例であるが、G成分およびB成分の輝度 レベルも、図と間様に周期的に変化する。従って、 RGB各成分のどれかの輝度レベルが極大になる ような位置を求め、この位置におけるRGB各成 分の輝度レベルを比較することにより、各々のス リット他の色な長を幼出することができる。

このようにして抽出された。 無3間(*)の以子 集念体の色符号系列と、第2図(a)の投影格子パ ターンの符号を耐とから、それぞれ符号をの長さ の部分符号系列を取り出して、これらが一致する かどうかを描べる.

上述のように、投影格子パターンが最大品高利 符号等で符号化されていれば、符号展列中に符号 艮の長さの部分系列は、ただ一度しか現れない。 従って、各々の部分系列が一致すれば、当該部分 系刃に含まれるスリット像は、一致した投影格子

- 12 -

バターンの部分系列のスリットに、各々対応して いることになる。このような処理は従来と呼ばれ、 空間的に符号化した核子を投影する方法では、基 本的なものである

この世号処理により、各々のスリット他を投影 格子に対応づけることができ、(1)式から当該ス リットが投影された物体の3次元を模が求められ る。しかしながら、このようにして計算できるの は、投影されたスリットなにおった物体上の点で ある。すなわち、スリットとスリットの開放にあ る物体上の点は、上記の復号処理からでは、計測 することができない.

一力、 第 2 例 (b) に示したように、 スリット MI 版は色で特徴づけされているが、その際、左右の 色の照用程度が多大でかつ、 おねの色の短期な形 が最小となるようにし、それらの間は一定の概念 で照明輝度が変化するようになされている。 このような投影格子パターンの照明輝度の変化 に対応して、第3回の機像機像の程度レベルも必 化し、第3図(b)のように、スリット後の算度レ

- 14 -

ベルIRには、左端に極大値が、右端に極小値が 取れる。

従って、×・・、≤×・、<×・・であるような、両像 面上の任意の×廃機値の点の輝度レベルが1・・、で あるとき、この点の投影格子パターン3面上の座 標値 υ・・、は、次式により推定できる。

よって影響を受けるため、投影格子パターンの原 明確度の変化を忠実に反映しなくなることがある。 このような場合には、上述のスリット権の経度 レベルが様大または報小になる無難上の点×・・・・ ×・・・と、投影様子のスリット間勝の両両点 u・・・・ u・との対応に調整が生ずるため、上記(2) 天台 よび(3) 天に 裏づいた 3 次元位置の単出が回難に かみ。

本共明は、このような問題を解決するため、第4 既に未共明の他の実施別による様子パターンの 成成例を示す。これは被計割機体に投影するため の投影格子パターンの構成例である。ここでは、 切に示すように、2 種類の投影パターンを使用する。第4 頃(16)はは、オン/オフの繰り返しより成 るスリット列の投影格子であり、従来の方後と列 ほに行り系列に従って、色づけされている。第4 医(b)は、一定の割合で順列降度が変化するよう になされたパターンであって、例えば、同の新で は左から右に順列降度が減少するようになされ、 これか2 回線と望されている。第4 図(c)は投影

$$u_{1x} = \frac{u_{1x} - u_{1x}}{1_{1x} - 1_{1x}} (1_{1x} - 1_{1x}) + u_{1x} - \cdots (2)$$

従って、(I)式より物体の3次元位置を求める

ことができ、第1図の2形様について示すと、

$$Z_{1x} = D \ 2$$
, ℓ , $/(\cup_{1x} \ell_1 + \times_{4x} \ell_1)$ (3)

となる。

以上説明したように、男を図の如く構成された 格子パターン3を被計画物体のに投影し、これを 選拿して第3回の如き! 故の画像を得ることによ リ、スリット像に沿った物体上の点ばかりでなく、 スリットをの影響にある任意の物体上の点の3次 元位質も計算できることになる。

上記の場合、第2別(a)のようなスリット的報 の順用環度を変化させた影略チパターンを使用 したこの方能によれば1枚の機能機能のあから、 対象物体の3次元位度を計測できるという特徴が ある。しかし、一方で第3頭(b)のような料像の 類慮レベルの変化は、第1頭の計劃装度の光学系。 物体の美行きや光帯的な性質など、様々な要固に

- 16 -

パターンの横方向に対する照明輝度の変化を示し た図である。

類4回(a)および(b)のように構成された2項類のパターンを接針制物は40に別々に投影し、紅線 転換する。この特別像した実像と、その素像を 走変して得られた程度レベルの変化の例を第5匹 に共す。 優において、(a)は色で作号化した核子 パターンを投影した時の美雄の例であり、(b)は 消費到像を積力向に太力向に定差したときの、R CB色度分の輝度レベルの変化の例、(c)は第4 別(b)の展別環度を変化させたパターンを投影し で得られた画像を、(b)と同様な位置で走変した ときの、輝度レベルの変化の例である。

到4回(4)の符号化格子パターンを投影して得られた第5回(4)の知き選権から、スリットなが を影きれている物は表面の3次元度度を計削する 力能は、既知である。すなわち、第5回(4)の確 体を横方向に走在すると、(b)に示すようにスリット他に対応して、展別的に出分が収れるため、 収載と対応して、展別的に出分が収れるため、 収載とベルの出の部の中本位度からスリット権

特別率 4-98106(6)

の中心要像座標を、当該面像座標のRGB成分の 比較によりの容易を、それぞれ始出することがで きる。抽出した色符号を並べた符号系列を上記と 間様な復分処理によって、投影格子のスリットに 対応づけることができる。

一方、 第 4 図(b)の 如き 照明 輝度 が一定の 割合 で変化するようなパターンを投影した画像を走査 すると、第5回(c)のように難度レベルが変化す る。対象とする被計測物体〇の表面の光学的な性 質が均一であるなら、このような程度レベルの登 化は、終計維物体の位置お上び形式に併なしてい る。従って、第5回(b)から絵出して隣接するス リット像の画面定様が、 x j 。 x j e 、であり、かつ、 上記御号処理により、これらの検影は子面でのな 振が、 u:, u:..であることがわかったとすると、 × ; ≦×≦× ; 。. であるような画面座標に対応する 投影格面での座標値りは、(2)式と同様に、

$$u_{\lambda} = \frac{u_{+} - u_{++}}{(1_{+} - 1_{++})} (1_{+} - 1_{++}) + u_{++}, \cdots (4)$$

ただし、1,, 1,... izはそれぞれx,, ×1...×における輝度レベルである。すなわち、 互いに弾接したスリット像に対応するスリットの 投影格子面里標から、これらのスリット像の間線 の任意の点の格子面座標が算出できるので、(1) 式により被計額物体の3次元位置を求めることが できることになる。

以上説明したように、符号化格子パターンと、 一定の割合で照明輝度が変化するようになされた パターンをそれぞれ被針類物体に投影して、各々 に対して理像を敬像することにより、これらの選 像から、被計測能体の3次元度機や前状を針測す ることができる。

また、本実施例では、一定の割合で照明程度が 変化するパターンを投影した画像の輝度レベルの 変化を輸出すればよいので、第2回の実施例の場 合のように、輝度レベルの極大/極小を検出する ときに生ずる肌差の問題がないという利点がある。 上記の方法においては、衝像を走者した輝度デ

ータから、連続したスリット像位置の輝度レベル

- 10 -

の差を正改に計測することが必要である。しかし たがら、 悪後の難度レベルは、 計測装置の数気的 特性や、計測条件。彼計測物体の性質などの影響 を受けやすいために、これらの影響をできるだけ 小さくするように、投影するパターンを選択する **必要がある**。

これには、①明明課度の変化の割合の大きいパ ターンを使用し、ノイズによる影響を小さくする。 ②対象物体の色や模様による影響を避けるため、 例えば均一な照明輝度のパターンを投影した遺像 を用いる。などの方法がある。これらについて、 以下に具体的に説明する。

新1回の計測装置において、格子パターンの投 影装着しの光顔の明るさは決まっているので、パ ターンの照明輝度の変化の割合を大きくするには、 松影パターン面を組かく分割して、分割した範囲 で新聞程度があたから最小まで変化するようにす るのがよい。しかし、上記集2回の実施例で述べ たように、光学系によるコントラストの低下など の影響によって、画像から輝度が挿大/樹小にな

- 20 -るような位置や輝度レベルを正確に求めることが 困難である.

これを解決するための投影パターン例を第6例 に示す。 周図(a)、(b)は、 第4図(c)と同様に、 投影パターンの機方向に対する簡明輝度の変化を 示したものであり、最大照明輝度をとる位置が交 互に異なるようになされている。一方、第4回の 他の宝施刷と開路に、ぬなどで符号化した核子パ ターンを投影した函像を処理することにより、ス リット像の投影格子面座標値は,が求められる。 また、純接したスリット像間にある任意の点に 対応する投影格子面影標値υ。は、照明輝度が一 定の割合で変化する役割パターンを開射した価値 の輝度レベルを計測することにより、(4)式に従 って求められる。上記2種類の投影パターンをそ れぞれ物体に照射した画像を遺像し、これらの画 像から輝度レベルを計測するに駆して、着目して いるスリット像の格子面座標値が、照明輝度が極 大/極小となる位置よりも違い投影パターンに対 応する海像を選択する。

特開平 4-98106(7)

すなわち、乳も図の別において、スソット車の 格子高度ではいが、u、5 u、C u、C u、O ときには、 パターン(3)に対応する画像を、u、5 u、C u、O 。 ときにはパターン(b)に対応する画像を、……,の ぬく選択し、当該過像から、(4)式に必要を輝度 レベルを計削する。以上の手段により、投影パタ ンの無別環境の場大/様小付近を避けて、計変 が可能になる。

なお、上記の時では第6回の向前を推開の投影 パターンを削かに限封した2枚の関準を使用したっ 、第6回(a)。(b)のパターンにそれぞれ異なっ た色を割り置くることにより、色パターンを環境 すれば、当体色パターンを照射した1枚の色面像 を獲権するだけでよい。ただし、この場合には、 色分類の完全な機能装置などを用いることにより、 智能色加多から前6回の2種類パターンに対応す る面像が始相できることが必要である。

一方、順像の輝度レベルは照明光ばかりでなく 対象とする被計測物体の色や模様にも大きく影響 されている。この種の影響を除くには、例えば、 制料解度が均一になるようなパターンを飲取した 画像を影響として、輝度レベルを制圧する。すな わち、上記(2)、(3)、(4)式における硼像の輝度 レベル1を、計割すべき画像の輝度レベルと、前 記均一な照明環度の投影パターンを倒針した画像 の輝度レベルとの比に乗き換えればよい。

なお、以上の放明では第Ⅰ次のパターン投影装置および機能基型の構成に関しては、百及しなかったが、例えば、パターン投影返電電子的な助 別が可能なを影用プロジェクタを、戦後を設にTVカメラを用い、それぞれコンピュータに接続して、投影パターンの別跡や、カメラから入力した 前後の処理を行えば、高速な計測を見与できる。 (毎期の参照)

以上説明したように本発明によれば、写今化格 チパターンを被計測物体に投影して、これを操像 した両線をもとに、特体の3次元的な位置や形状 を計測するに限して、別別輝度が一定の割合で む にするようなされて、パターンを開時に投影するこ とにより、上記格子パターンのスリットとが投影

- 23 -

されている即分ばかりでく、 面像内に機像されている、スリット光とスリット光の間の物体表面の任意の位質をも、計画することができる。

すなわち、従来の方面では、上記行号化格デバターンのスリット光に向った計劃しかできないため、 送計期始後を体の形状を世間することが能しいという問題があり、これに対処するために、例えば、計劃したスリットデータを増切して欠落した形状データを模定するなどの手段がとられる。しかし、この場合、補間によりどのように推定するかが難しい問題であるし、またその処理にも時間がかかることになる。これに対して本界明では、上記のような解処処理を行わないで、スリット間のデータを直播計算することができることになる。

また、木苑明によれば、符号化格子などの数値 の投影パターンを対象物体に投影した演像を、機像するだけでよいので、写真として記録すること も変見である。

4. 図面の効単な説明

第1回は本発明方法を実施するための計劃装置

- 24 -

の基本的な環境間、第2 図は本典明の一実能例で ある前1 図の除すたつンの環境例で、計算、 図は第1 図の機能を整度に得られた機能の一例数 び間度レベルの変化例を示す図、第4 図は本発現 の他の実施例による節1 図の絡子パターンの供成 りを示す例、第5 図は第4 図の 2 推築の格子パターン と一次を物体に改彰したときの高強の一例及び対域 レベルの変化例を示す例、第6 図は周期的に照明 即度を一定の研究で変化させた 2 推奨の依影パターンの照明関度を初の一例である。

1 … 校影装置、 2 … 機像装置、 3 … 格子パターン、 O … 被計劃物体、 L.1 … 投影レンズ、 L.2 … 機像レン

特許出頭人 日本雜信電話换式会址

代理人 葉野恒司

- 26 -

特別平 4-98106(8)

